제8차 대학 TLO 실무자를 위한

“TLO 백문백답” 과정

특허의 이해와 활용1

2008. 12. 19.

스카이특허법률사무소
변리사 오위환

목차

- 선행기술조사의 중요성 및 절차
- 등록료 미납으로 권리가 소멸된 특허의 구제방안
- 국내 및 해외특허 출원부터 등록 시까지 소요비용
- 특허 명세서 구성 및 작성 시 유의사항
- 특허맵의 이해와 활용방법
- 선발명주의와 선원주의의 이해
- 심사청구제도, 출원공개제도, 우선권제도 이해
- 패밀리특허와 외국특허공보, 국제특허분류(IPC) 이해
- 특허출원 시 대리인 선임 또는 직접출원에 대한 방법 및 유의사항

선행기술조사의 중요성 및 절차

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

연구단계별 선행기술조사 목적

연구기획
- 아이디어수집
- 중복연구 방지
- 기술개발동향 파악

→

연구개발
- 종래기술 문제점 참고
- 연구자료 수집

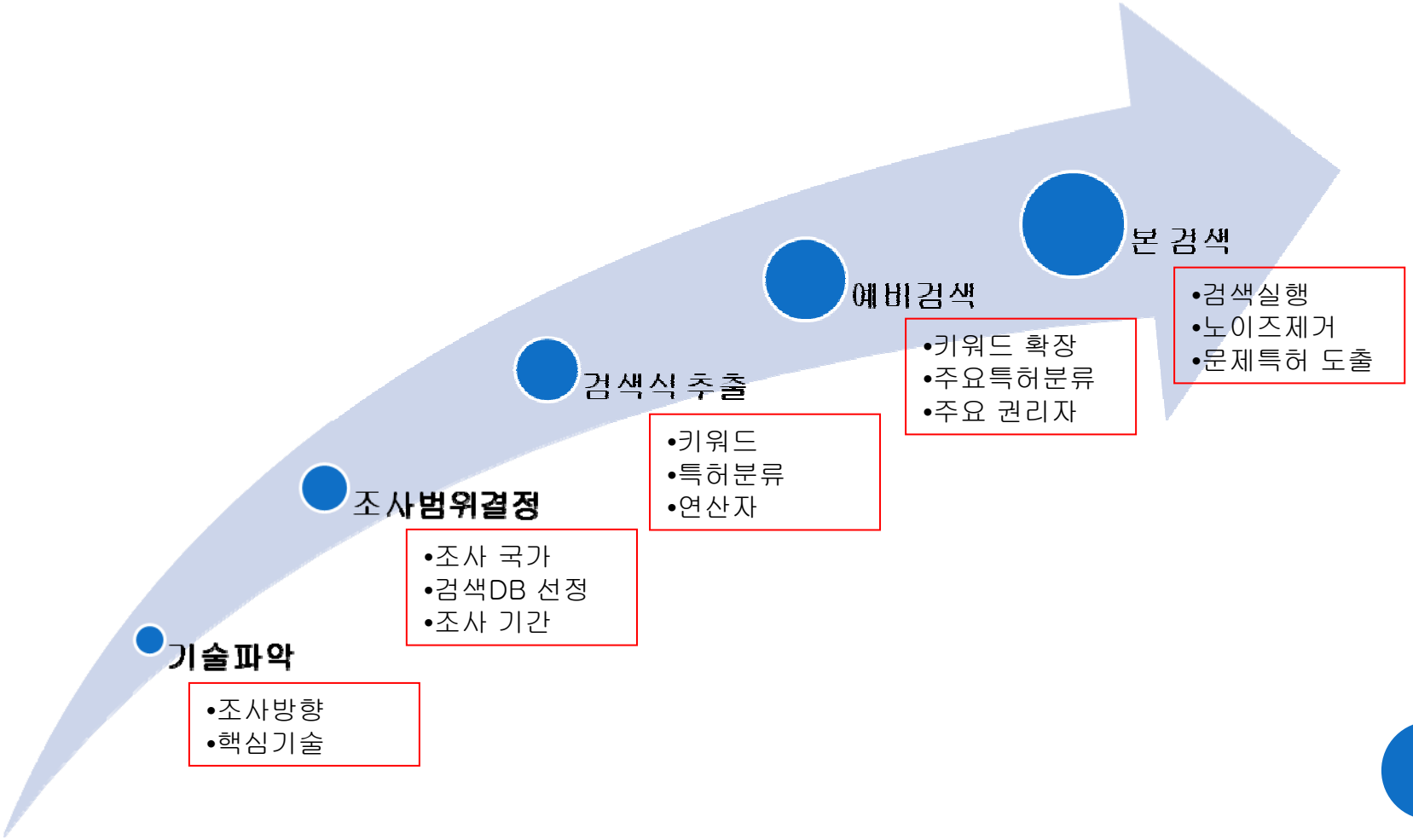
→

연구성과관리
- 특허가능성 파악
- 적절한 권리범위 설정 판단자료

→

연구성과활용
- 잠재수요기업 조사
- 타인의 특허침해여부 조사

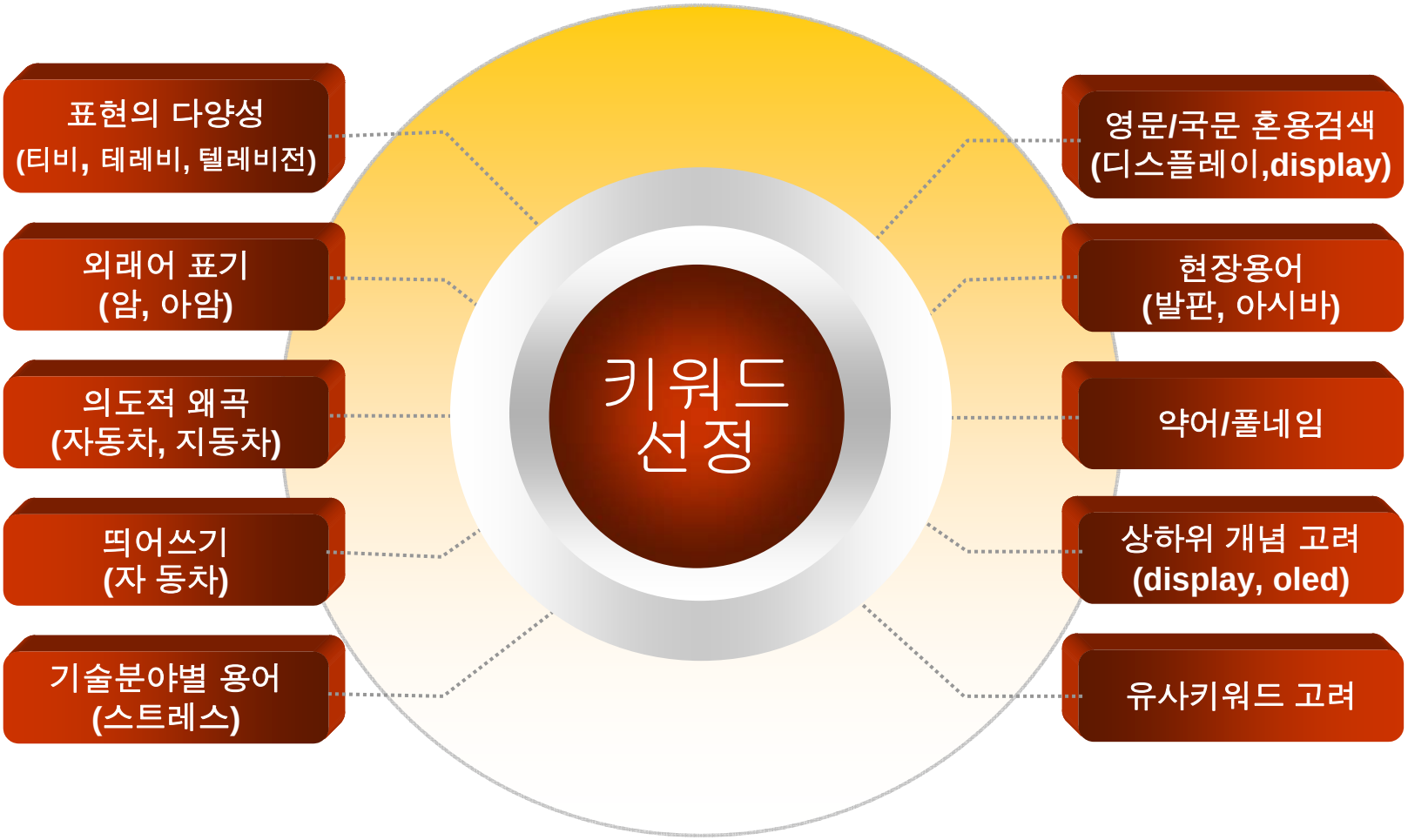
선행기술 조사 절차


기술파악
•조사방향
•핵심기술
조사범위결정
•조사 국가
•검색DB 선정
•조사 기간
검색식 추출
•키워드
•특허분류
•연산자
예비검색
•키워드 확장
•주요특허분류
•주요 권리자
본 검색
•검색실행
•노이즈제거
•문제특허 도출

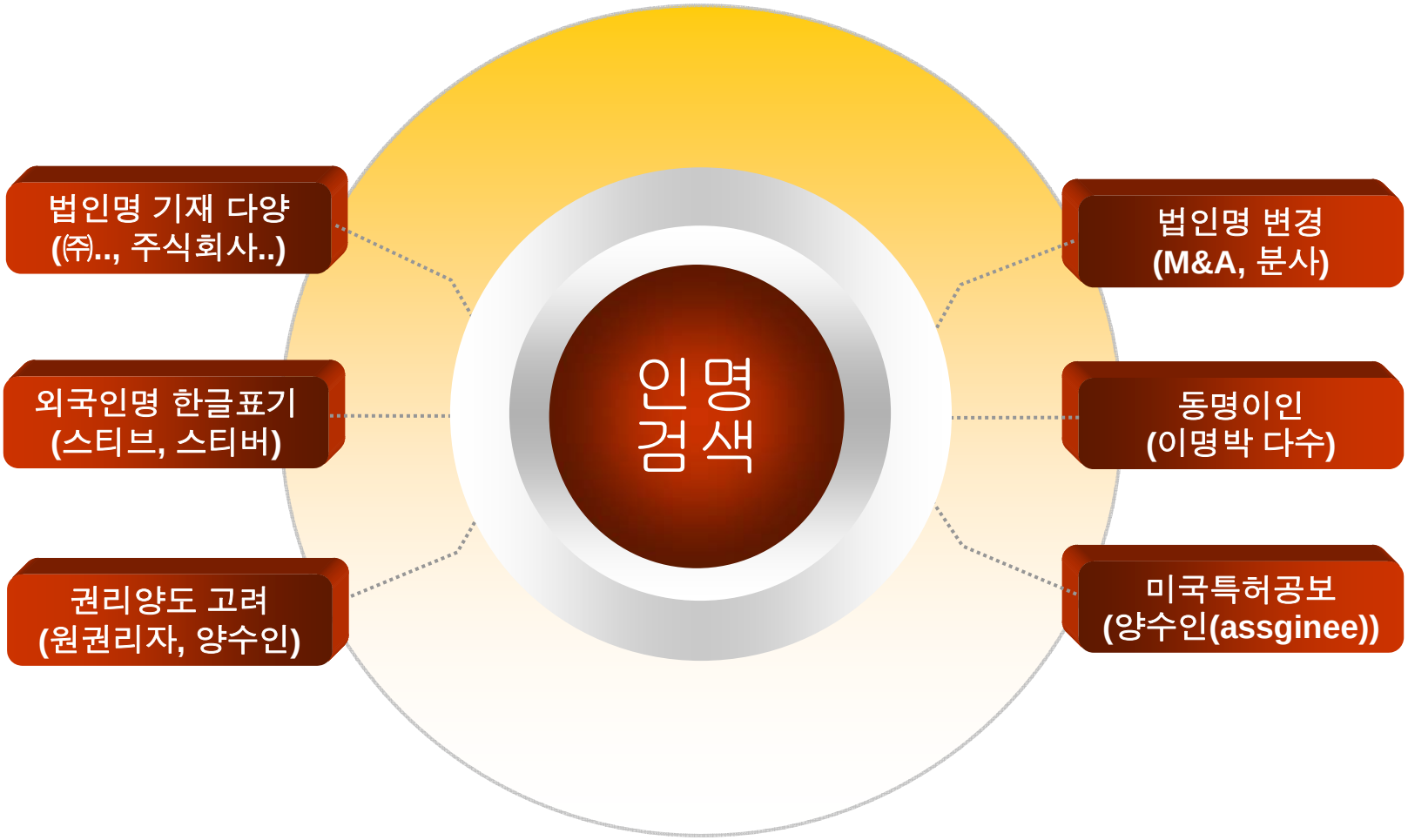
검색필드

검색어	번호	일자	키워드	인명	분류
검색필드	출원번호 공개번호 공고번호 등록번호 우선권번호	출원일자 공개일자 공고일자 등록일자 우선권일자	발명명칭 요약 청구범위 전문	출원인 발명자 특허권자 대리인 심사관	IPC UPC F-Term ECLA

키워드 선정 시 유의 사항


키워드 선정
표현의 다양성 (티비, 테레비, 텔레비전)
외래어 표기 (암, 아암)
의도적 왜곡 (자동차, 지동차)
띄어쓰기 (자 동차)
기술분야별 용어 (스트레스)
영문/국문 혼용검색 (디스플레이,display)
현장용어 (발판, 아시바)
약어/풀네임
상하위 개념 고려 (display, oled)
유사키워드 고려

인명 검색 시 유의 사항


인명
검색
법인명 기재 다양
(㈜.., 주식회사..)
외국인명 한글표기
(스티브, 스티버)
권리양도 고려
(원권리자, 양수인)
법인명 변경
(M&A, 분사)
동명이인
(이명박 다수)
미국특허공보
(양수인(assginee))

검색범위의 설정

검색범위 좁힘
알파에러
(검색한 자료가 원하는 자료에서 누락되는 문제)
베타에러
(검색된 자료가 원하는 자료가 아닌 문제)
검색범위 넓힘
적절한 검색범위 설정

특허정보 검색 사이트

	표기	URL	TEXT	비용
국내특허	KIPO	www.kipris.or.kr	국내/해외 특허정보	무료
국제출원	WIPO	www.wipo.org	97년 이후 자료만 제공	무료
미국특허	USP	www.uspto.gov	미국특허정보	무료
유럽특허	EPO	www.european-patent-office.org	97년 이후의 자료를 비정기적 (월평균 1회 이상)으로 반영	무료
통합정보	DEL	www.delphion.com	해외특허 정보	유료
	EP	ep.espacent.com	유럽/해외 특허정보	무료
	WIPS	www.wips.co.kr	국내/해외 특허정보	유료

일본어 검색 방법

IPDL 特許電子図書館
Industrial Property Digital Library
独立行政法人 工業所有権情報・研修館
National Center for Industrial Property Information and Training
To English Page
工業所有権情報・研修館ホームページへ
特許庁ホームページへ
お問い合わせ先
IPDLヘルプデスク
受付時間：9:00-21:00
TEL：03-5690-3500
：helpdesk@ipdl.inpit.go.jp
ご利用について
各サービスのご利用方法
FAQ（よくある質問と回答）
マニュアル等ダウンロード
ご利用上の注意
セキュリティソフトの設定
アンケートにご協力下さい
ご注意
IPDLではブラウザのJavaScriptとCookieの機能を用いて検索を行っています。
IPDLをご利用の際はこの設定を有効にするようお願いいたします。
プライバシーポリシーについて
トピックス
更新履歴
2008/07/29 ・「平成20年度 企業の知的財産・法務担当者のための検索エキスパート研修［上級］（第2回）」の受講者を募集します。
2008/07/18 ・「平成20年度知的財産権研修（第3回）」の受講者募集のお知らせ
2008/07/18 ・「平成20年度特許審査基準討論研修（第2回／化学）」の受講者募集のお知らせ
2008/07/07 ・任期付職員（特許審査官補）採用（追加募集）の募集要項
メンテナンスのお知らせ
予定一覧
検索メニュー
初心者向け検索
商標検索
特許・実用新案検索
意匠検索
経過情報検索
審判検索
出願手続きについて
出願方法・様式
出願に必要な料金
パソコン出願
工業所有権に関する一般的なご相談
公報・資料のご提供
公報・資料の閲覧
開放特許情報のご提供
特許流通データベース
アイデアデータベース
特許情報アドバイザー
人材育成
知財関連人材の育成
公報発行予定表
文献蓄積情報
関連HPリンク
Copyright (C) 1999-2008 JPO and INPIT
あなたは 50,730,791人目の来館者です。

IPDL 特許電子図書館
Industrial Property Digital Library

独立行政法人 工業所有権情報・研修館
National Center for Industrial Property Information and Training
INPIT

工業所有権情報・研修館ホームページへ　特許電子図書館トップページへ　To English Page

初心者向け　特許・実用新案　意匠　商標　審判　経過情報

特許・実用新案検索　Patent & Utility Model Search

以下のサービスが利用可能です。希望するサービスをクリックして下さい。

1. **特許・実用新案公報DB**　English
   文献番号から特許・実用新案の各種公報を検索できます。また、PDF表示をすることもできます。
2. **特許・実用新案文献番号索引照会**　English
   各種番号から特許・実用新案の各種公報を検索することができます。
3. **公報テキスト検索**
   書誌的事項・要約・請求の範囲のキーワード、分類（FI・IPC）等から特許・実用新案の公報を検索できます。
4. **公開特許公報フロントページ検索**
   キーワードまたは文献番号から公開特許公報のフロントページ（書誌的事項・要約・代表図面）を検索できます。
5. **特許分類検索**
   特許庁内で利用しているFI・Fタームやファセット、IPCを用いて特許・実用新案の各種公報を検索できます。
6. **パテントマップガイダンス（PMGS）**　English
   キーワードを用いてFI・Fターム、IPCの説明を参照できます。
7. **パテントマップガイダンス（旧）**
   平成12年10月以前のFI・Fターム、IPCの説明を参照できます。

NAVER
일본어단문번역
검색
로그인
네이버 | 메일 |
통합검색
'일어번역' 다이렉트검색
다이렉트검색 도움말
단문 번
일어 단문
는 300자 이상은 번역되지 않습니다.
마이크로 렌즈 어레이
한 → 일
단문번역
사이트 번역기
네이버 인조이재팬 – 한/일 단문번역
단문번역
日→韓
マイクロレンズアレイ
복사하기
번역하기
내 홈페이지에 단문번역창 달기
닫기
스폰서링크
일본어단문번역 플러스통번역 – 일본어단문번역 통번역대학출신, 확실
http://www.plustrans.net

公報テキスト検索

メニュー　ニュース　ヘルプ

●公報種別

☑公開特許公報（公開、公表、再公表）　☐特許公報（公告、特許）　☐和文抄録

☐公開実用新案公報（公開、公表、登録実用）　☐実用新案公報（公告、実用登録）

各検索項目毎の入力方法はヘルプを参照してください。

検索項目選択	検索キーワード	検索方式
発明の名称	マイクロレンズアレイ	OR
	AND	
公開日		OR
	AND	
IPC		OR
	AND	
出願人／権利者		OR
	AND	
公報発行日		OR

●表示　◉項目/レイ　表示　○PDF表示

一覧　ット件数10　の時に表示可能です。

ヒット件数585件

検索　一覧表示　クリア

検索可能範囲　パテントマップガイダンス

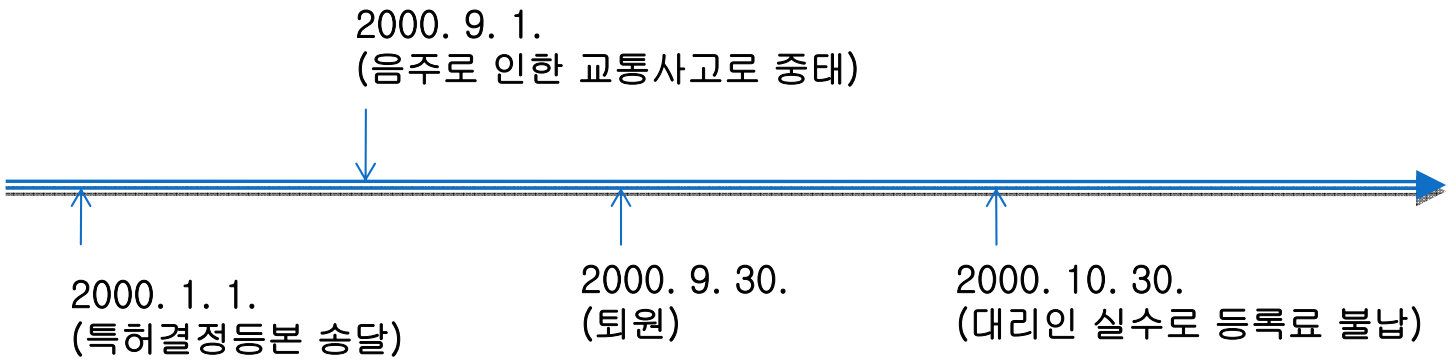
ヒット件数 38

1. 特開2008-152040 マイクロレンズアレイの製造方法、マイクロレンズアレイ、それを用いた有機ELラインヘッド及び画像形成装置
2. 特開2008-152039 マイクロレンズアレイの製造方法、マイクロレンズアレイ、それを用いた有機ELラインヘッド及び画像形成装置
3. 特開2008-152038 マイクロレンズアレイの製造方法、マイクロレンズアレイ、それを用いた有機ELラインヘッド及び画像形成装置
4. 特開2008-097032 マイクロレンズアレイ、液晶表示素子および投影型液晶表示装置
5. 特開2008-083685 バックライト装置に用いられるマイクロレンズアレイシート及びマイクロレンズアレイシートを製造するためのロール版
6. 特開2008-058494 マイクロレンズアレイシートの製造方法
7. 特開2008-040028 マイクロレンズアレイ及びその製造方法
8. 特開2008-026437 ガラス製マイクロレンズアレイの製造方法、ガラス製マイクロレンズアレイ
9. 特開2007-322503 マイクロレンズアレイの製造方法
10. 特開2007-316153 カラー撮像素子のマイクロレンズ製造方法及びカラー撮像素子のマイクロレンズアレイ
11. 特開2007-279223 マイクロレンズアレイ基板および液晶表示装置
12. 特開2007-264351 マイクロレンズアレイシート及びその製造方法
13. 特開2007-249158 光部品アレイ素子、マイクロレンズアレイおよびその製造方法
14. 特開2007-206601 マイクロレンズアレイの製造方法、マイクロレンズの製造方法、及び表示装置の製造方法
15. 特開2007-199565 マイクロレンズアレイシートおよび透過型スクリーン
16. 特開2007-193266 マイクロレンズアレイの製造方法及びマイクロレンズ基板
17. 特開2007-183364 感光性ガラスペースト、光学部品の製造方法およびマイクロレンズアレイ基板の製造方法
18. 特開2007-183363 マザー基板、このマザー基板の製造方法およびマイクロレンズアレイ基板の製造方法
19. 特開2007-156021 非球面マイクロレンズ用金型の製造方法、マイクロレンズ製造方法、マイクロレンズ、マイクロレンズアレイおよびレーザ光源
20. 特開2007-142425 集積化ハイブリッドマイクロレンズアレイを有するフォトニックデバイス
21. 特開2007-133037 マイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルおよびその製造方法
22. 特開2007-127981 マイクロレンズアレイおよびその形成方法、固体撮像素子、液晶表示装置、電子情報機器
23. 特開2007-121057 微細マイクロレンズアレイの形状測定方法
24. 特開2007-114454 マイクロレンズアレイとその製法
25. 特開2007-114441 マイクロレンズアレイ及びマイクロレンズアレイの製造方法
26. 特開2007-108400 マイクロレンズアレイ及びそれを有する光学機器
27. 特開2007-101661 マイクロレンズアレイおよびマイクロレンズアレイの製造方法

등록료 미납으로 권리가 소멸된 특허의 구제방안

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

등록료 납부마감 판단 예



등록료 납부마감일자는?

특허(등록)료(2009. 1. 1)

권리		설정등록 (1~3년분)		연차등록료 4~6년	7~9년	10~12년	13~15년	16~25년
특허	기본료	★매년 22,000원씩 66,000원		매년 51,000원	매년 114,000원	매년 240,000원	매년 360,000원	
		★매년 15,000원씩 45,000원◆		매년 40,000원♣	매년 100,000원♣			
	가산료 (청구범위의1항마다)	★매년15,000원씩 45,000원		매년 23,000원	매년 38,000원	매년 55,000원	매년 55,000원	
		★매년13,000원씩 39,000원◆		매년 22,000원♣				
실용신안	기본료	★매년17,000원씩 51,000원		매년 36,000원	매년 76,000원	매년 160,000원	매년 240,000원	
		★매년 12,000원씩 36,000원◆		매년 25,000원♣	매년 60,000원♣			
	가산료 (청구범위의1항마다)	★매년 4,000원씩 12,000원		매년 9,000원	매년 14,000원	매년 20,000원	매년 20,000원	
디자인	심사	★매년 25,000원씩 75,000원		매년 35,000원	매년 70,000원	매년 140,000원	매년 210,000원	
	무심사	★매년 1디자인마다 25,000원씩 75,000원		매년 35,000원	매년 70,000원	매년 140,000원	매년 210,000원	
상표		상표(서비스표) 지정상품 추가	211,000원	* 다류지정의 경우 1상품류 구분마다 211,000원 가산 (존속기간갱신의 경우 256,000원 가산)				
		존속기간 갱신	256,000원					

•설정등록료★ (◆ 2009. 1. 1. 이후 등록결정서 발송된 경우)
•연차등록료 연차등록료 (♣ 정상납부기한이 2009. 1. 1. 이후인 경우로 2009. 1. 1. 이후 최초 납부시)

특허(등록)료 납부 기간 및 금액

구 분	기 간	납부금액
설정등록료 납부 (특허법 제79조)	등록결정일로부터 3개월 이내	등록료
추가납부 (특허법 제81조)	특허료 납부기간 만료일로부터 6개월 이내	특허(등록)료의 2배
특허권 회복 (특허법 제81조의 3)	추가납부기간 만료일로부터 6개월 이내 + 사유 종료일부터 14일 이내 (단, 책임질 수 없는 사유; 천재지변, 전쟁, 치명적인 교통사고 등)	특허(등록)료의 2배
	추가납부기간 만료일로부터 3개월 이내 (단, 실시중인 특허발명)	특허(등록)료의 3배

특허료 납부 금액 사례

단위 천원

구분	08"등록료	09"등록료	10"등록료	11"등록료	12"등록료	13"등록료	합계
2008	29,100						29,100
2009	29,100	29,100					58,200
2010	29,100	29,100	29,100				87,300
2011	49,800	29,100	29,100	29,100			137,100
2012	49,800	49,800	29,100	29,100	29,100		186,900
2013	49,800	49,800	49,800	29,100	29,100	29,100	236,700

※ 총 5개의 청구항을 가진 특허가 매년 100건 이상 등록된다고 했을 때 6년동안의 연차료 총액

특허연차료 관리 전략

연차료 통합관리

- 거래하는 특허사무소에서 각각 관리하는 경우 연차료 불납으로 소멸되는 특허가 생길 위험이 큼

일정기간 이후 원칙적 포기 검토

- 일정기간 이후(예를 들면 4년차 이후)의 특허는 자동포기하고, 중요 특허의 경우 선별적으로 특허 유지
- 포기 건의 경우 발명자와의 협의를 통해 발명자에게 소유권 이전

청구항별 포기 검토

- 소액이전을 위한 특허유지 등의 경우 불필요한 청구항 포기

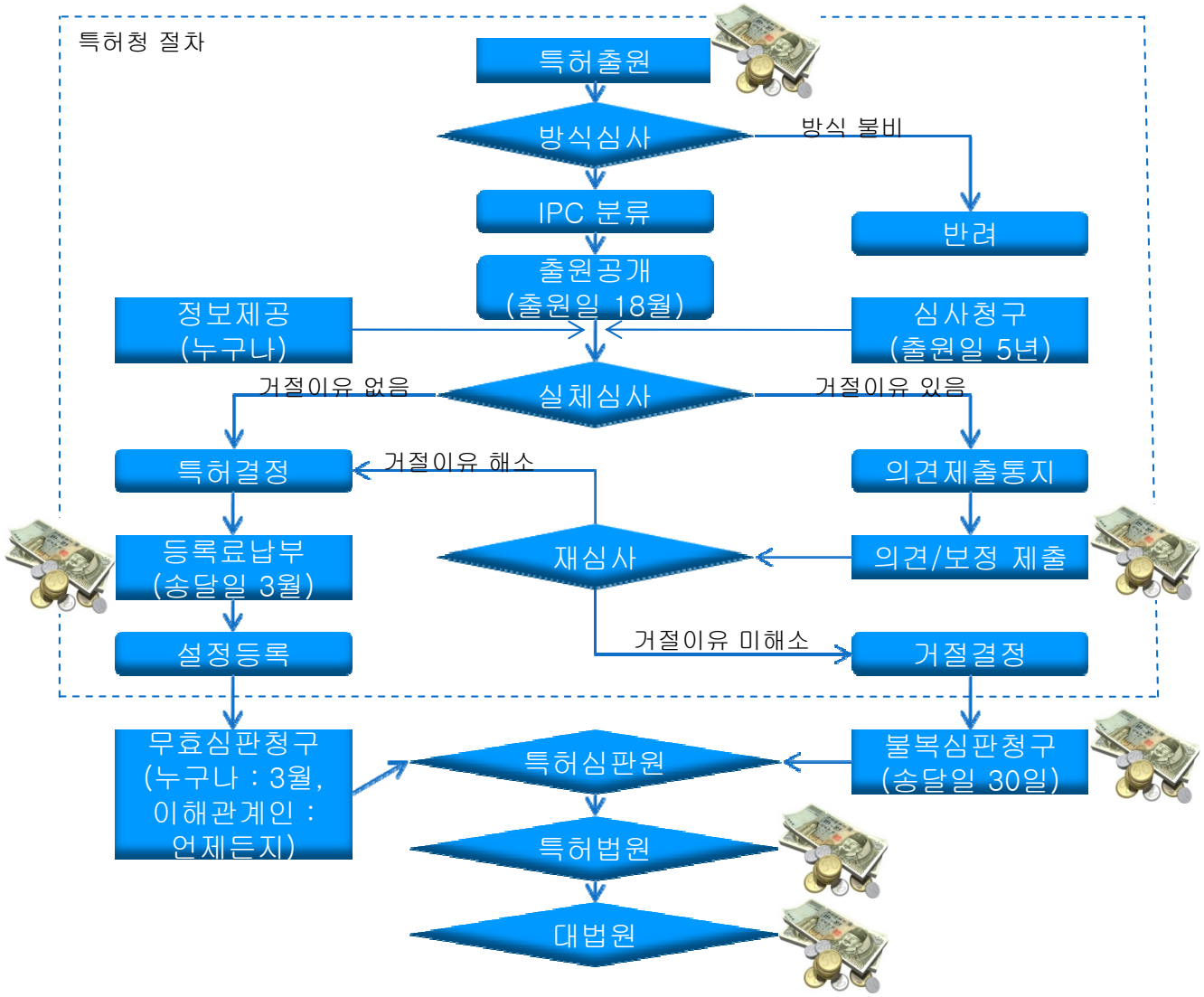
기업에게 연차료 부담

- 공동연구과제 결과물의 경우 연구계약단계에서 연차료를 기업에게 부담시키는 조항 마련

국내 및 해외특허 출원부터 등록 시까지 소요비용

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

국내특허출원 비용발생 단계



국내 특허출원 소요비용

특허청 관납료

구 분		금 액
전자출원(온라인 FD)	기본료	29,000원 (+@)
	가산료	명세서 도면 20면 초과 1면마다 1,000원 가산
서면제출	기본료	39,000원
	가산료	명세서 · 도면 20면 초과 시 초과1면마다 3,400원 가산
우선권주장 신청료	기본료	26,000원
	가산료	초과 1주장마다 17,000원 가산
우선권 주장 추가료	추가료	매건 17,000원
심사청구료	기본료	141,000원
	가산료	청구범위 기본 1항 초과시 초과 1항당 32,000원 가산
우선심사신청료	기본료	167,000원
	가산료	청구범위 기본1항 초과시 초과 1항마다 32,000원 가산
보정료	절차보정	매건 5,000원
등록료	기본료	66,000원(1~3년차)
	가산료	청구범위의 1항마다 18,000원 가산

대리인 수수료(부가세)

등급제

- S급, A급, B급, C급 차등 수수료
- 바람직하나, 등급관리 어려움

누진제

- 기본료, 추가료(청구항, 도면, 명세서 면수 등)
- 합리적이나, 비용 예상하기 어려움

정액제

- 특허 건당 얼마로 고정
- 예산잡기 쉬우나, 비합리적

※국내 출원에서 등록까지 소요비용 : 80만원~300만원 정도까지 다양

PCT출원 소요비용

단위 천원

내 역		금 액
국내비용	대리인 착수금	₩1,000~2,000
	번역료	₩30~40 /page
관납료	기본료	₩1,027
	조사료	₩225
	송달료	₩45
	우선권 송달료	₩0.5
	PCT-SAFE	-₩220
	소계	₩1,077.5
기타	국제예비심사 청구 등	₩400~500
합 계		₩3,500~5,000

개별국 출원 소요비용(미국)

단위 천원

국내비용		해외비용		
내역	금액	내역	대리인비용	관납료
출원착수금	₩1,000~2,000	출원료 (양도증, IDS, 우선권서류 등)	US$1,500~3,000	US$600~1,500
중간비용 (회당)	₩300~800	의견서/보정서 제출비용	US$1,000~3,000	
등록비용	₩1,000~2,000	등록료	US$500~1,000	US$1,000
합 계	₩2,300~4,800	합 계	US$3,000~7,000	US$1,600~2,500

※해외 출원에서 등록까지 소요비용 : 800만원~1,500만원 / 개국 정도

특허비용 관리 전략

등급별 비용 차등 관리

- 출원목적에 따라 수수료 차등관리
- 핵심원천기술(S급), 우수기술(A급), 일반기술(B급), 실적용(C급)

심사청구제도 활용

- 핵심원천기술, 실적용 등 심사청구를 유보하여 초기비용을 최소화시킨 후 기술이전 활동
- 해외출원 시 각국 심사청구유예기간 적극 활용

해외출원루트의 적절한 선택

- PCT출원 적극활용(PCT국제단계에서 적극적 기술이전)
- 진입국가가 2개국 이하일 때는 개별국 출원이 유리

소수 정예로 분야별 대리인 선정

- 일정이상 출원 건을 확보하여 주고 합리적 수수료 적용

특허 명세서 구성 및 작성 시 유의사항

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

특허명세서의 구성

- 특허
  - 요약서
    - 요약
    - 대표도
    - 색인어
  - 명세서
    - 발명의 명칭
    - 발명의 상세한 설명
      - 기술분야
      - 배경기술
      - 발명의 내용
        - 해결하고자 하는 과제
        - 과제 해결 수단
        - 효과
      - 발명의 실시를 위한 구체적인 내용
  - 특허청구범위
    - 청구항 1
    - 청구항 2
    - 청구항 3
    - 청구항 4
  - 도면의 간단한 설명
  - 도면
    - 도 1
    - 도 2
    - 도 3

발명의 명칭

기재요령	• 발명의 내용을 간명하게 표시할 수 있는 명칭 기재 • 영문 명칭을 {}안에 한글 명칭 다음에 병기
기재 예	• 자동차용 범퍼{AUTOMOBILE BUMPER}
유의사항	• 기술마케팅/활용을 고려하여 명칭 기재 • 일반적으로 경쟁업체의 특허검색에 노출되지 않는 용어 선택

기술분야 및 배경기술

기술분야

- 특허 받고자 하는 발명의 기술분야를 명확하고 간결하게 기재
- (예) 본 발명은 자동차 엔진에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 자이로스코프의 원리를 이용하여 연소효율이 향상된 자동차 엔지에 관한 발명이다.

배경기술

- 발명의 이해 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술 명시
- 종래기술의 문헌 정보를 알고 있는 때에는 그 문헌의 명칭, 발간일, 기재 페이지 등 기재

유의사항

- 구체적인 특허번호 기재 신중(무효자료)
- 본 발명과의 구체적 비교 신중(권리범위 제한)

발명의 내용

해결하고자 하는 과제	• 특허를 받고자 하는 발명이 과제로 하고 있는 종래 기술의 문제점 등을 기재
과제의 해결수단	• 구체적 해결수단 기재 • 일반적으로는 청구범위에 기재된 발명 그 자체가 해결수단이 되므로 청구범위에 기재된 발명 기재
효과	• 특허를 받고자 하는 발명이 종래의 기술과 비교하여 우수하다고 인정되는 사항을 기재
유의사항	• 해결하고자 하는 과제를 제한하지 말 것 • 청구항 별로 효과 기재(청구항마다 무효심판 청구 대상)

실시예 및 도면의 간단한 설명

실시예

- 당업자가 그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 예를 적어도 하나 이상 기재

도면의 간단한 설명

- 첨부한 '도면' 각각에 대하여 각 '도면'이 무엇을 표시한 것인가를 간단히 기재

유의사항

- 실제 실시하지 않더라도 회피설계 고려하여 다양한 실시예 기재(권리범위 해석)
- 도면은 영업비밀이 아닌 범위 내에서 구체적으로 도시(보정 또는 정정 고려)

특허청구범위

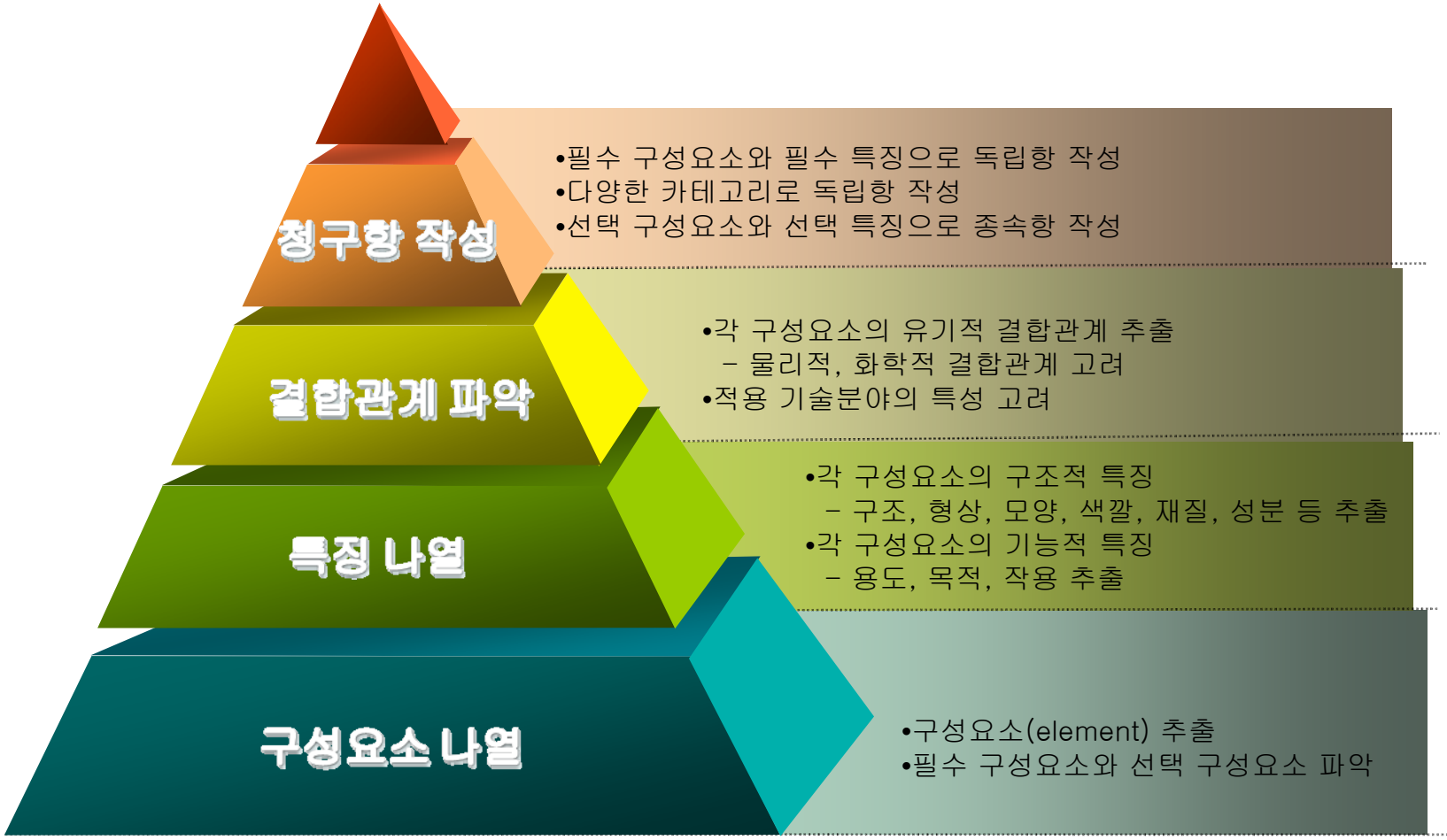
기재요령

- 특허청구범위를 발명의 상세한 설명에 기재된 내용 범위안에서 과제의 해결수단과 매칭되도록 작성
- 하나의 청구항에는 하나의 발명의 사상
- 청구항에는 독립항을 기재하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항 기재할 수 있음

기재요건

- 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 될 것
  - 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 것
  - 발명의 상세한 설명의 용어와 불일치
- 발명이 명확하고 간결하게 기재
  - 발명의 구성요소 단순 나열
  - "필요에 따라", "주로" 등 불분명한 용어

특허청구범위 작성 요령


청구항 작성
결합관계 파악
특징 나열
구성요소 나열
•필수 구성요소와 필수 특징으로 독립항 작성
•다양한 카테고리로 독립항 작성
•선택 구성요소와 선택 특징으로 종속항 작성
•각 구성요소의 유기적 결합관계 추출
– 물리적, 화학적 결합관계 고려
•적용 기술분야의 특성 고려
•각 구성요소의 구조적 특징
– 구조, 형상, 모양, 색깔, 재질, 성분 등 추출
•각 구성요소의 기능적 특징
– 용도, 목적, 작용 추출
•구성요소(element) 추출
•필수 구성요소와 선택 구성요소 파악

특허청구범위 작성시 유의사항

선행기술과 구별되게

- 선행기술과 구별되게 구성, 작용효과상 차이 기재(특허요건 고려)

권리범위 포괄적으로

- 구성요소 적게, 청구범위 용어 포괄적, 불필요한 제한 금지
- 단계적인 청구범위로 작성(독립항은 포괄적, 종속항은 구체적)

보정/정정을 고려하여

- 포대 금반언(File wrapper estoppel) 고려
- 삭제 보정의 경우 권리범위 제한 가능성

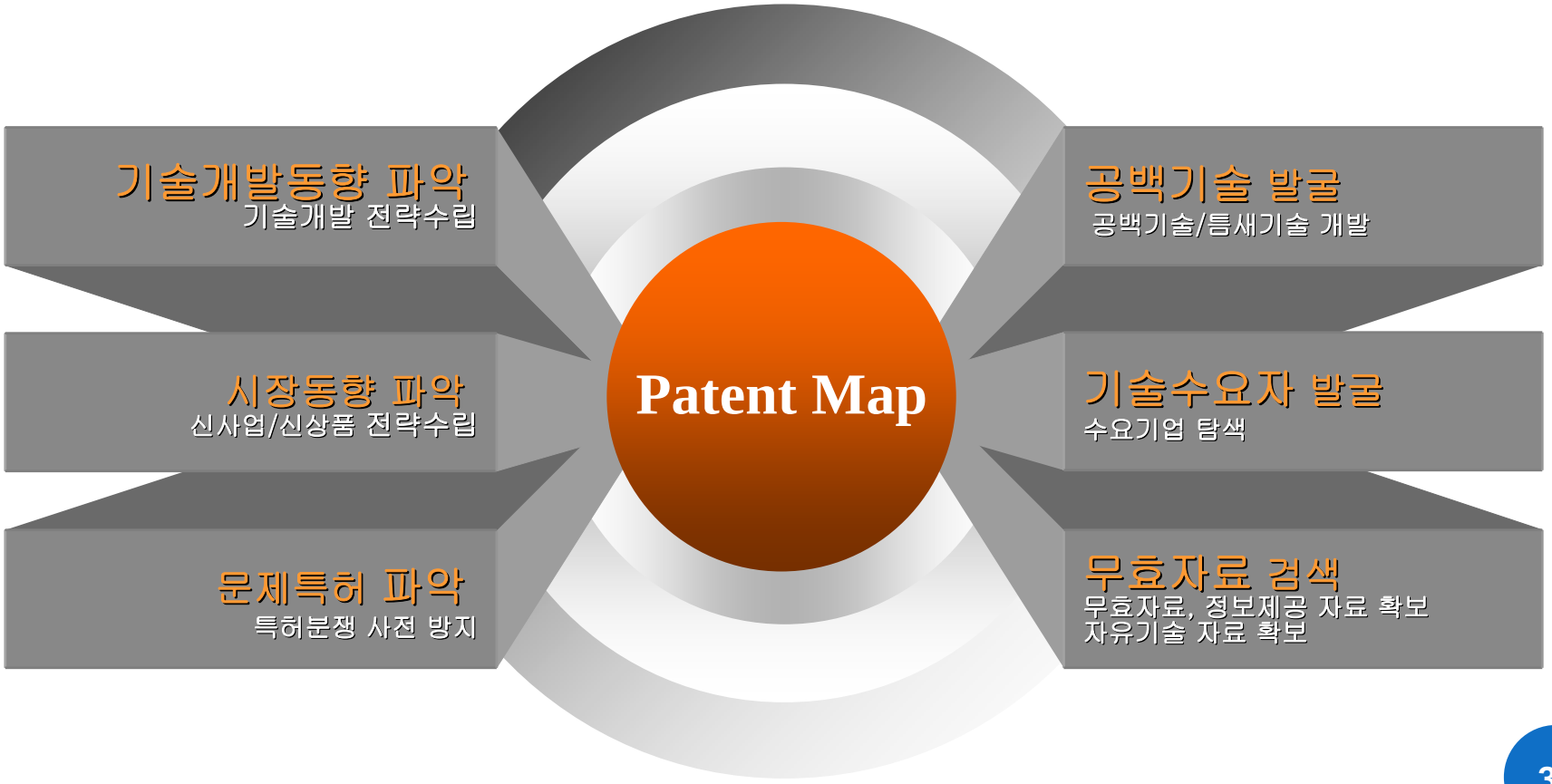
침해행사가 용이하도록

- 가능하면 물건/물질발명으로(제조방법도 함께 청구)
- 누구에게 권리행사할 지 고려(생산업자, 조립업자, 사용업자 등)
- 요소기술 vs 전체기술 모두 청구

특허맵의 이해와 활용방법

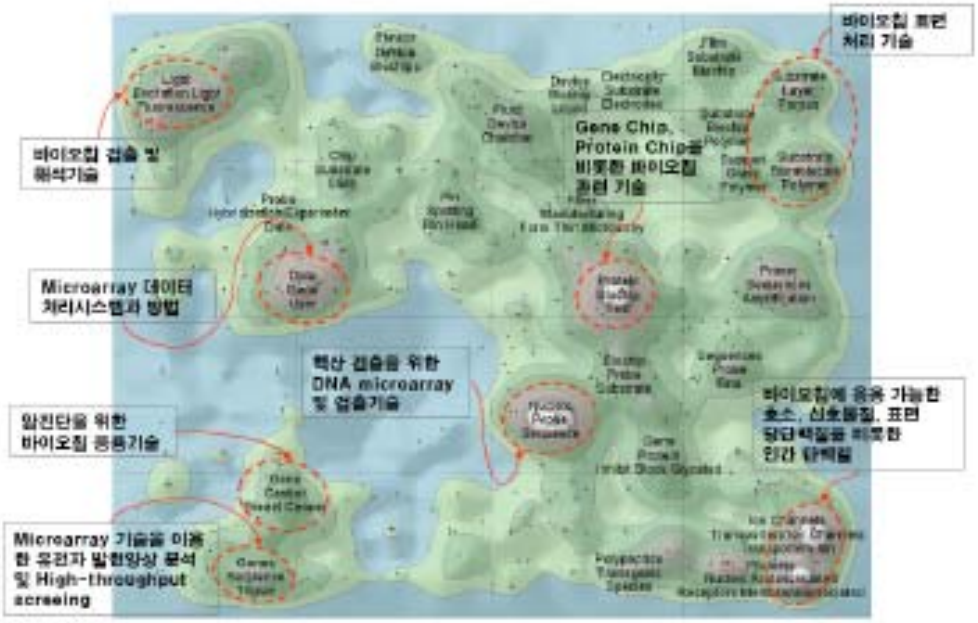
2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

특허맵의 활용


기술개발동향 파악
기술개발 전략수립
시장동향 파악
신사업/신상품 전략수립
문제특허 파악
특허분쟁 사전 방지
Patent Map
공백기술 발굴
공백기술/틈새기술 개발
기술수요자 발굴
수요기업 탐색
무효자료 검색
무효자료, 정보제공 자료 확보
자유기술 자료 확보

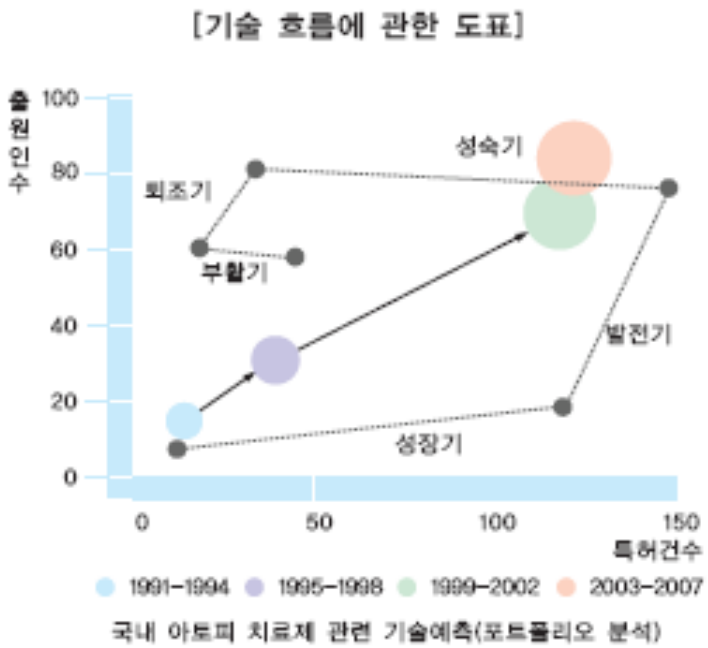
특허등고선

「바이오칩 관련 세계 특허 등고선」



※특허등고선을 통해
- 중점 연구 기술
- 해당 기술에 대한 시장 성숙도
- 틈새기술, 미개척 분야 확인

기술흐름도



※기술흐름도를 통해 해당기술의 수명주기상의 위치 확인

주요 출원인 분석

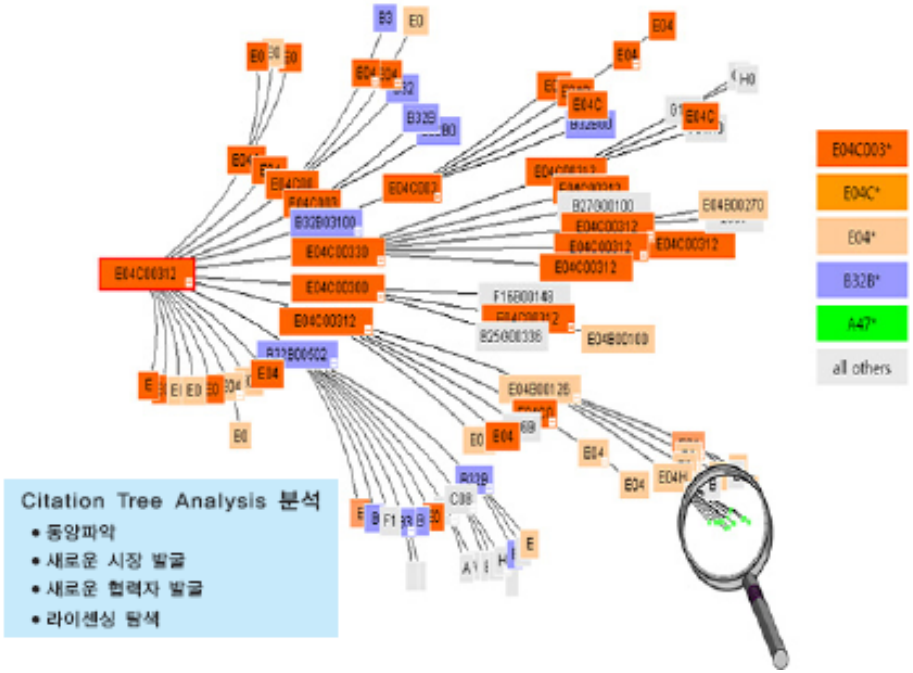
[주요 출원인에 대한 분석]

국내 아토피 치료제 관련 출원기관별 특허 출원 및 등록 현황

※주요 출원인 분석을 통해
•해당 기술을 리드하고 있는 연구팀 확인
•해당 기술분야의 선두 기업 확인
•수요기업 탐색

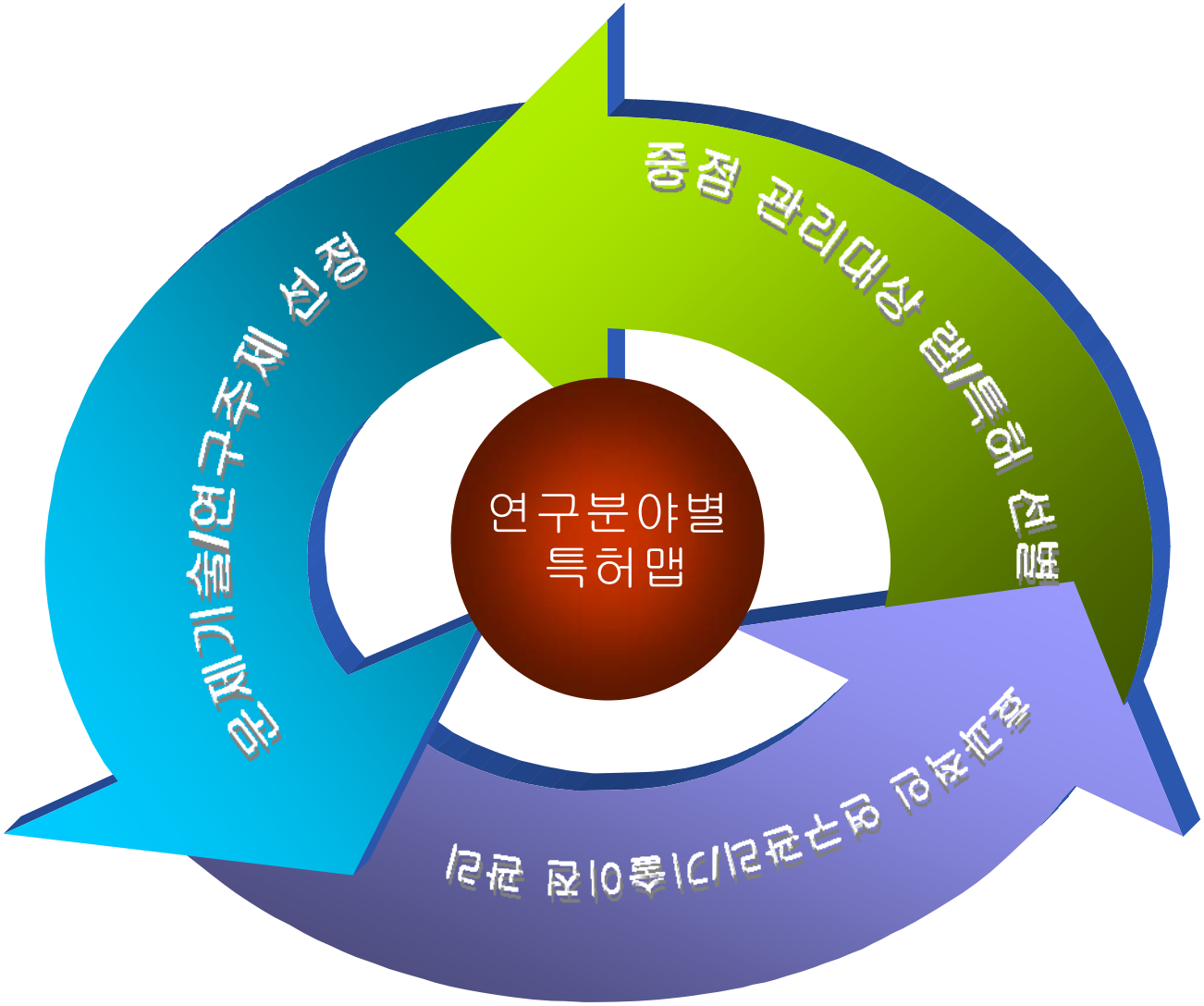
인용정보 분석

[인용정보 분석]



※인용정보 분석을 통해
•해당 기술분야의 원천 특허
•해당 기술분야의 기술동향
•사업/연구 파트너 발굴
•수요기업 탐색

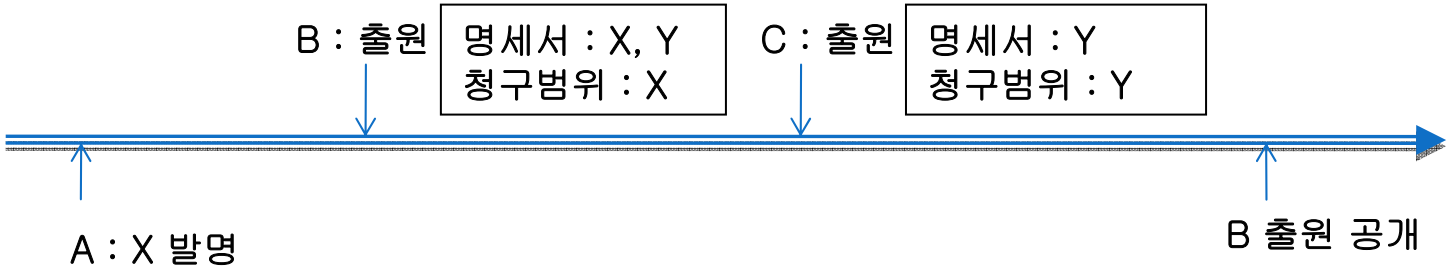
특허맵의 활용



선발명주의와 선원주의의 이해

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

선출원 여부 판단 예(한국)



A는 특허 받을 수 있는가?
B는?
C는?

선발명주의 VS 선원주의

제도의 취지

- 특허제도는 발명을 공개한 대가로 독점권을 부여하는 것을 기본 원칙
- 동일한 발명에 대해 중복해서 특허권을 인정하는 것은 특허제도의 취지에 반함
- 동일한 발명에 대하여 2건 이상의 출원이 있는 경우 어느 출원에 대하여 특허를 부여할 것인지와 관련하여 선출원주의와 선발명주의라는 2개의 입법례가 있음

선발명주의

- 동일한 발명에 대해 발명의 선후를 기준으로 판단
- 미국

선출원주의

- 동일한 발명에 대해 출원의 선후를 기준으로 판단
- 한국, 일본 등 미국을 제외한 대부분의 국가

선발명주의의 장단점

선발명주의

장점

- 가장 빠른 발명자를 보호한다는 특허법의 취지에 부합
- 모방출원에 대한 보호 용이
- 직무발명의 경우 종업원(발명자) 보호에 적합

단점

- 발명의 선후를 판단하기 어려움
- 발명의 공개가 늦어짐
- 권리관계가 불안정
- 저촉심사 등 심사절차가 복잡

확대된 선원주의

구 분	내 용
의 의	•동일한 후출원을 거절시킬 수 있는 선원의 범위를 명세서/도면에 기재된 전범위로 확대 •선원주의 문제점 보완
적용요건	•당해 출원이 선 특허출원/실용신안출원 후일 것 •당해 출원 후에 선 특허출원/실용신안출원이 공개/등록공고 되었을 것
적용예외	•발명자/고안자가 동일한 경우 •출원인이 동일한 경우
판단방법	•동일성 여부 판단 •당해 출원의 특허청구범위와 선 출원의 명세서/도면 비교
위반효과	•정보제공사유 •거절이유 •무효사유

확대된 선원 VS 선원 비교

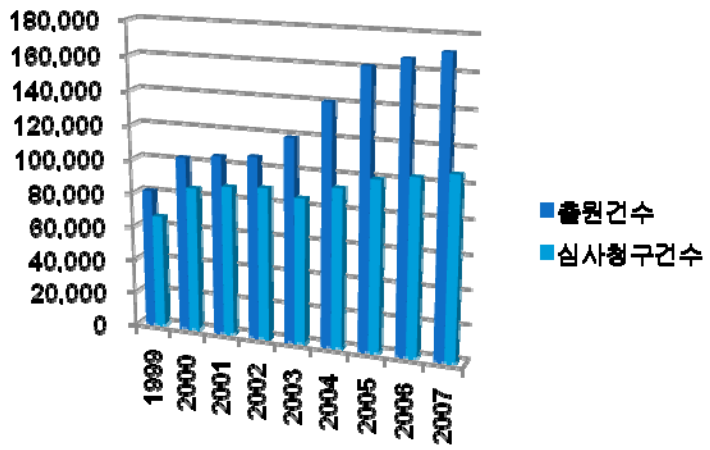
구 분	확대된 선원 (특허법 제29조 3항)	선원 (특허법 제36조)
동일(같은 날) 출원	적용 안됨	적용
출원일/발명자 동일	적용 안됨	적용
판단 방법	동일성 판단	동일성 판단
판단 대상	선출원의 명세서/도면 vs. 당해 출원의 청구범위	선출원의 청구범위 vs. 당해 출원의 청구범위
무효/취하의 경우	공개되면 적용	적용 안됨
선출원 공개 여부	필수 조건	관계없음

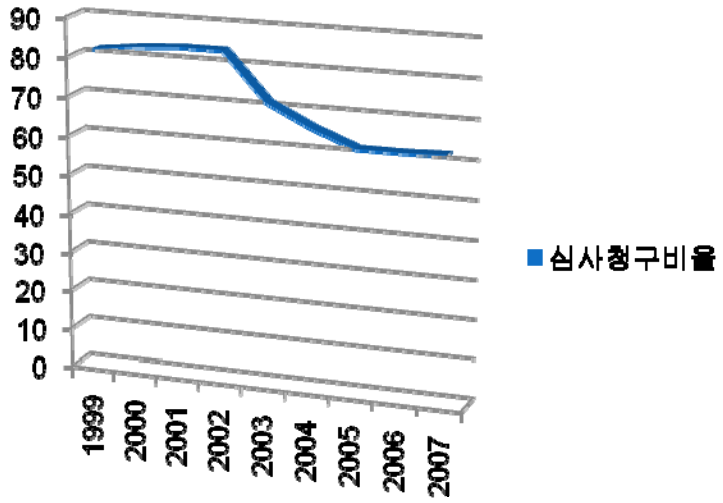
심사청구제도, 출원공개제도, 우선권제도 이해

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

심사청구제도의 이해

※ 심사청구제도란
: 심사청구가 있는 출원에 대해서만 심사하는 제도(특허법제59조)





지식재산권통계, 2007, 특허청

일괄 심사청구의 문제점

출원/유지 비용 부담 증가	• 심사청구료가 차지하는 비중이 높음 • 조기 등록에 따른 특허 유지비용 증가
자진보정 기회 감소 및 claim 보정기회 상실	• 명세서 하자에 대한 보정 기회 축소 • 특허양수인 또는 침해자의 제품 및 실시형태를 고려한 청구범위 보정기회 상실로 가치 하락 요인
국내우선권주장 기회 감소	• 1년 이내에 특허등록 시 우선권 주장 기회 감소 • 추가 개량발명의 패키지 권리화를 제한하여 기술이전 시 가치 하락 요인
분할출원 기회 감소	• 다양한 권리확보를 위한 분할출원 기회 감소
해외출원 기간 단축	• 등록 공고 이후에는 신규성 상실로 해외출원 불가능 (1년 도과 시) • 해외출원 기회축소로 기술이전 시 가치 하락 요인

심사청구제도의 활용

심사청구 여부에 대한 판단기준 마련

- 대학평가, 과제평가 등을 고려할 때 특허출원 및 특허등록 건수 중요성은 인정
- 대학의 특허관리 목적(기술이전/라이센싱) 및 특허 재정을 고려할 때 적은 특허비용으로 조기 기술 이전 중요성 대두(미공개 신기술 박람회 등)
- 출원목적, 발명수준 등에 따른 심사청구여부 및 심사청구 시기에 대한 가이드라인 마련

심사청구 보류 활용 가능 사례

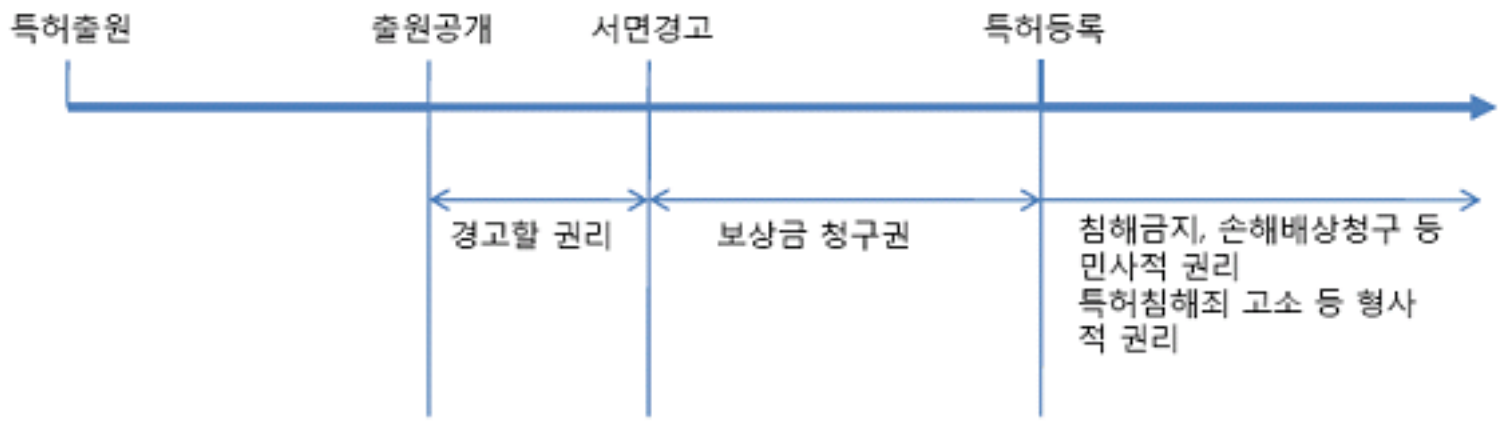
- 적용분야, 실시형태 등이 확인되지 않은 원천기술
- 우선권 확보 후 개량발명이 예상되는 출원(국내우선권 주장 출원 가능성 확보)
- 현재 시장성/사업성 여부가 불투명하여 향후 시장 관찰이 필요한 경우
- 출원자체에 의미가 있는 실적용 출원

해외출원 시 각국 심사청구 유예기간 활용

- 대학이 직접 해외출원하기 쉽지 않음(특허비용 각국당 약 1,000만원 소요)
- 심사청구 유예 기간 활용(일본 3년, 중국 3년 등) -> 적은 비용으로 해외출원 후 기술이전

출원공개제도의 이해

※ 출원공개제도란
: 출원인의 신청에 의하여(조기공개제도) 또는 특허출원 후 1년 6개월 경과 후에 특허청에 계속 중인 출원을 심사여부와 관계없이 일반에 공개하는 제도 (특허법제64조)



<출원단계별 효과>

조기공개의 장단점

조기 공개

장점

- 경고할 권리 발생
- 보상금 청구권 발생
- 기술공개 통한 기술마케팅 수단

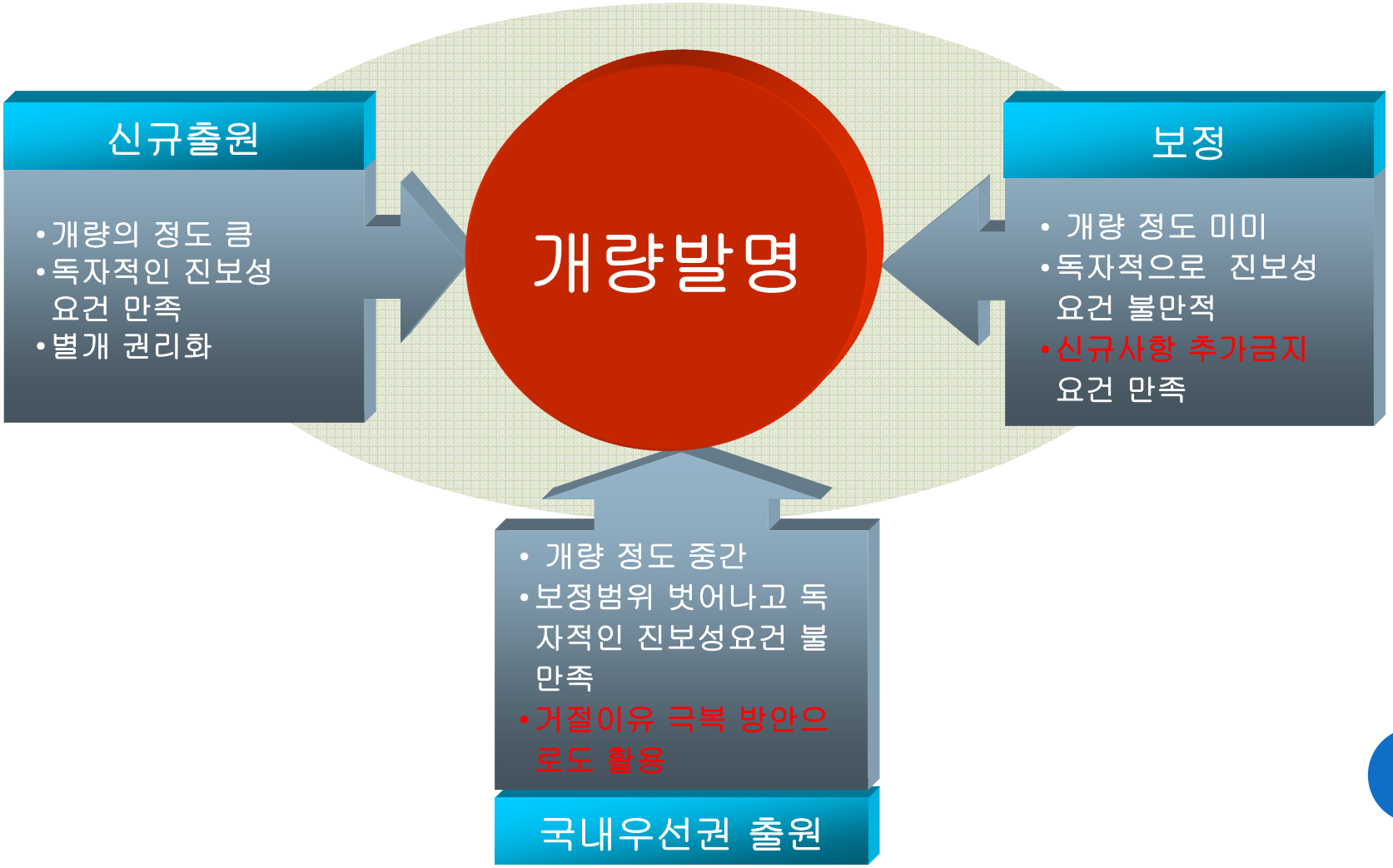
단점

- 해외출원 가능기간 1년으로 단축
- 제3자의 모방 용이
- 경쟁사에게 정보제공의 기회제공

조약우선권제도 VS. 국내우선권제도

구분	조약우선권	국내우선권
취지	•해외출원에 따른 출원인 부담경감 •발명의 국제적 보호	•개량발명의 적절한 보호 •내외국인간 형평성 도모
요건	•최초 정규출원인 또는 승계인 •출원의 정규성 및 최선성 •출원내용의 동일성 •제1국 출원일부터 1년	•선출원인 또는 승계인 •선출원의 계속 •출원내용의 동일성 •선출원일부터 1년
절차	•출원서에 취지, 출원국, 출원년월일 기재 •우선권 증명서류 제출	•출원서에 취지/선출원 기재 •증명서류 제출 불필요
효과	•출원일 소급효 •요건불비 : 우선권주장만 불인정	•출원일 소급효 •선출원 취하 간주 •요건불비 : 우선권주장만 불인정

개량발명의 권리화 루트

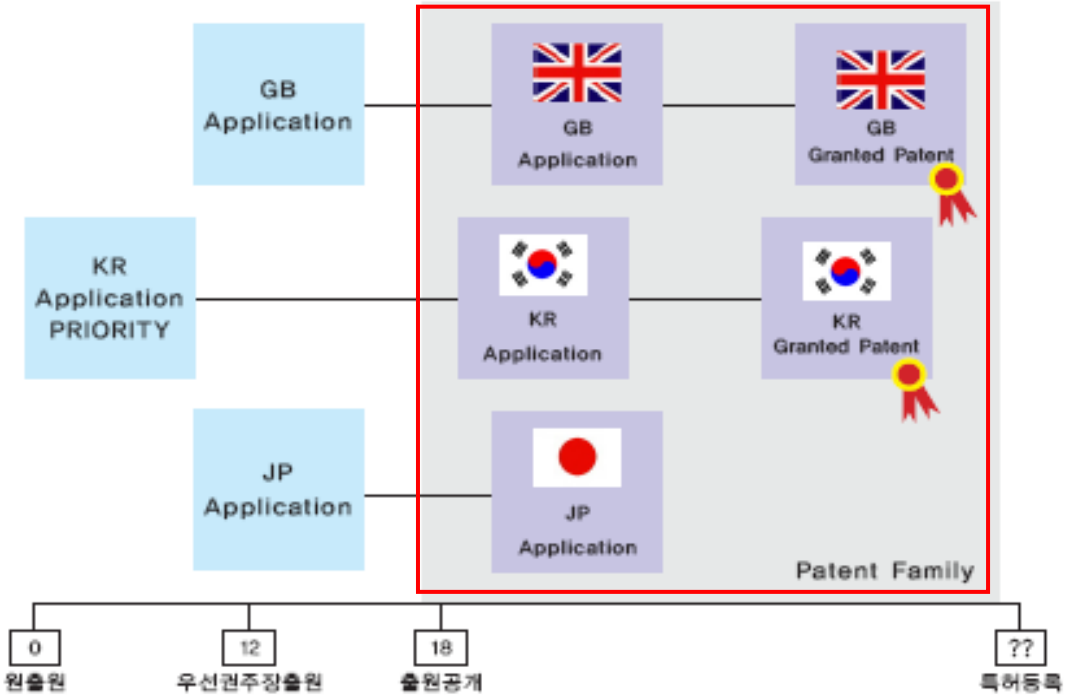

신규출원
•개량의 정도 큼
•독자적인 진보성 요건 만족
•별개 권리화
개량발명
보정
• 개량 정도 미미
•독자적으로 진보성 요건 불만적
•신규사항 추가금지 요건 만족
• 개량 정도 중간
•보정범위 벗어나고 독자적인 진보성요건 불만족
•거절이유 극복 방안으로도 활용
국내우선권 출원

패밀리특허와 외국특허공보, 국제특허분류(IPC) 이해

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

패밀리 특허(PATENT FAMILY)의 이해

※ 패밀리 특허(Patent Family)는
- 특정의 특허 출원과 관련된 모든 특허 및 특허 출원
- 동일한 우선권(Priority) 데이터를 가짐



패밀리 특허(PATENT FAMILY) 확인 예시

(19) **United States**
(12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2008/0031523 A1**
Kim et al. (43) **Pub. Date: Feb. 7, 2008**

(54) **INFORMATION PARTS EXTRACTION FOR RETRIEVING IMAGE SEQUENCE DATA**

(76) Inventors: **Whoi-Yul Kim**, Seoul (KR); **Min-Seok Choi**, Seoul (KR); **Hyun-Chul Kim**, Dong-gu (KR)

Correspondence Address:
KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP
2040 MAIN STREET
FOURTEENTH FLOOR
IRVINE, CA 92614 (US)

(21) Appl. No.: **11/881,797**

(22) Filed: **Jul. 27, 2007** 우선권 정보

Related U.S. Application Data

(63) Continuation of application No. PCT/KR2005/003205, filed on Sep. 27, 2005.

(30) **Foreign Application Priority Data**

Jan. 27, 2005 (KR) 10-2005-0007594

Publication Classification

(51) **Int. Cl.**
G06K 9/46 (2006.01)
(52) **U.S. Cl.** 382/203; 382/259

(57) **ABSTRACT**

A method of extracting information parts, and a recorded

본 건과 관련된 Family Patent 정보

CC	Pat. No.	Kind	Pat. Date	Title
CN	101116108	A	2008.01.30	-
KR	0679124	B1	2007.01.30	이미지 시퀀스 데이터 검색을 위한 정보 요소 추출 방법 및 그 방법을 기록한 기록매체
KR	2006-0086700	A	2006.08.01	이미지 시퀀스 데이터 검색을 위한 정보 요소 추출 방법 및 그 방법을 기록한 기록매체
US	20080031523	A1	2008.02.07	Information parts extraction for retrieving image sequence data
WO	WO06/090654	A1	2006.08.03	Information parts extraction for retrieving image data

등록

공개 with Search Report

INPADOC Basic Patent

원출원

KR 2005-0003205 (2005.09.27

International Patent Documentation Center는 EPO 관할 데이터 베이스로서, 패밀리 특허 및 그에 대한 법적 상태에 대한 정보를 관리한다.

패밀리 특허(PATENT FAMILY) 정보의 활용

경쟁사 해외 권리 현황 파악 자료

- 각 국가에 출원한 내용 및 등록현황 파악

분쟁 시 정보제공 또는 무효자료 확보 수단

- 각 국가의 심사 자료(인용참증) 활용

기술 내용 파악을 위한 참고 수단

- 해독 가능한 언어(영어, 일어 등)를 사용하는 국가에 출원된 패밀리 특허를 통해서 특허내용 파악

특허의 가치 및 중요도 판단 자료

- 해외 특허비용을 고려할 때 패밀리 특허의 수가 많을 수록 중요한 특허일 가능성 높음

한국특허공보의 이해

발행국 및 특허문헌 종류

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

공개정보

IPC분류

(51) Int. Cl.
G11B 7/09

(11) 공개번호 특2003-0010070
(43) 공개일자 2003년02월05일

출원정보

(21) 출원번호 10-2001-0044837
(22) 출원일자 2001년07월25일

출원인정보

(71) 출원인 삼성전기주식회사
대한민국
442-803
경기 수원시 팔달구 매탄3동 314번지

발명자정보

(72) 발명자 권오병
대한민국
441-390
경기도수원시권선구권선동신동아대원아파트508동903호

대리인 정보

(74) 대리인 청운특허법인

심사청구 유무

(77) 심사청구 있음

발명명칭

(54) 출원명 광축 조정용 광픽업 액츄에이터

요약정보

요약

본 발명은 광축 조정용 광픽업 액츄에이터에 관한 것으로서, 대물렌즈(L)가 설치된 블레이드를 포함하는 액츄에이터 어셈블리(1) 및 상기 블레이드의 포커스, 트래킹조정을 위한 마그네트(2)를 고정 설치하기 위한 내측요크(11), 외측요크(12)가 절곡 형성되고, 저면에 구면부(14)가 일체로 형성된 요크 플레이트(10)와; 상기 요크 플레이트(10)의 저면에 구면부를 수용하는 범위에서 광축을 보정하기 위한 조정 플레이트(20)와; 상기 조정 플레이트(20)의 저면을 밀착 고정하기 위한 다이 캐스팅(30)과; 상기 요크 플레이트(10), 조정 플레이트(20) 및 다이 캐스팅(30)을 포함하여 데크 패널 상으로부터 이동 가능하게 설치되는 픽업베이스(5)와; 상기 조정 플레이트 상에 관통 설치되어 다이 캐스팅에 체결 설치되는 조정나사(40)를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 바, 본 발명은 픽업 베이스의 구형홈부에 안착 되도록 설계된 요크 플레이트 저면에 일체로 적용된 구면부위는 픽업 베이스에 직접적이지 않은 독립적으로 합체될 수 있는 조정 플레이트와, 픽업 베이스 상에 설치되며, 그 상부에 조정 플레이트를 합체 설치하기 위한 다이 캐스팅의 설치로 미리 요크 플레이트의 구면부 부위와 상기 조정 플레이트의 구형홈부의 결합에 따른 액츄에이터의 롤링변화를 없애고, 상기 조정 플레이트로 하여금 다이 캐스팅에 조정나사의 체결을 통해 대물렌즈의 광축 조정을 원활하게 할 수 있어 제품의 생산성 향상 및 불량을 최소화 할 수 있는 효과가 있다.

미국특허공보의 이해

US006338508B1

(12) **United States Patent**
Kleefeldt

(10) **Patent No.: US 6,338,508 B1**
(45) **Date of Patent: Jan. 15, 2002**

(54) **MOTOR-VEHICLE LATCH SYSTEM WITH POWER OPEN**

(75) Inventor: **Frank Kleefeldt**, Heiligenhaus (DE)

(73) Assignee: **Kiekert AG**, Heiligenhaus (DE)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/526,111**

(22) Filed: **Mar. 15, 2000**

(30) **Foreign Application Priority Data**

Mar. 24, 1999 (DE) 199 13 390

(51) **Int. Cl.**[7] **E05L 3/06**

(52) **U.S. Cl.** **292/201**; 242/216; 70/264

(58) **Field of Search** ..... 70/264; 292/216, 292/201, DIG. 23

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,974,886	A	*	12/1990	Kleefeldt et al.	292/201
5,419,597	A	*	5/1995	Brackmann et al.	292/201
5,638,712	A	*	6/1997	Kuroda	70/268
5,667,260	A	*	9/1997	Wyerstall	292/201
5,699,685	A	*	12/1997	Jahrsetz et al.	70/264
5,715,713	A	*	2/1998	Aubry et al.	292/216
5,762,384	A	*	6/1998	Bartel	292/216
5,765,884	A	*	6/1998	Armbruster	292/216
5,802,894	A		9/1998	Jahrsetz	
5,853,206	A	*	12/1998	Kleefeldt et al.	292/201
6,145,354	A	*	11/2000	Kondo et al.	70/279.1
6,168,216	B1	*	1/2001	Nakajima et al.	292/201

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

EP	0 896 118	2/1998

* cited by examiner

Primary Examiner—Robert J. Oberleitner
Assistant Examiner—Devon Kramer
(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Herbert Dubno; Andrew Wilford

(57) **ABSTRACT**

A door latch for a motor-vehicle central-latch system has a housing, a locking element displaceable on the housing between a door-bolt-holding position and a door-bolt-releasing position, and a pawl displaceable on the housing between a retaining position holding the locking element in its bolt-holding position and a freeing position allowing the locking element to assume its bolt-releasing position. A release lever pivotal on the housing into an actuated position can put the paws into the freeing position. A outside operating lever is pivotal on the housing between actuated and unactuated positions and a main locking lever is pivotal on the housing by an electric motor between locked and unlocked positions. A link engageable between the main locking lever, the outside operating lever, and the release lever serves for, when the main locking lever is in the unlocked position and the outside operating lever is in its unactuated position, coupling the outside operating lever to the release lever to displace same into its freeing position on movement of the outside operating lever into its actuated position. When the main locking lever is in the locked position and the outside operating lever is in its actuated position, the link displaces the release lever into its freeing position on movement of the main locking lever into its unlocked position. Normally the link, when the main locking lever holds in the locked position, decouples the outside locking lever from the release lever.

7 Claims, 6 Drawing Sheets

발명의명칭

발명자정보

출원인 정보

출원정보

우선권정보

기술분류정보

인용정보

등록정보

대리인정보

요약정보

일본특허공보 예시

(19)日本国特許庁（ＪＰ）　(12) 公 開 特 許 公 報（Ａ）　(11)特許出願公開番号

特開2000－123547

（P2000－123547A）

(43)公開日　平成12年４月28日(2000.4.28)

(51)Int.Cl.⁷　識別記号　ＦＩ　テーマコード（参考）

Ｇ１１Ｂ　27/00　Ｇ１１Ｂ　27/00　Ｃ　５Ｄ１１０

審査請求　未請求　請求項の数２　ＯＬ　（全 15 頁）

(21)出願番号　特願平10－294942

(22)出願日　平成10年10月16日(1998.10.16)

(71)出願人　000005821
松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者　江草　洋
大阪府門真市大字門真1006番地　松下電器産業株式会社内

(72)発明者　太田　豊
大阪府門真市大字門真1006番地　松下電器産業株式会社内

(74)代理人　100097445
弁理士　岩橋　文雄　（外２名）

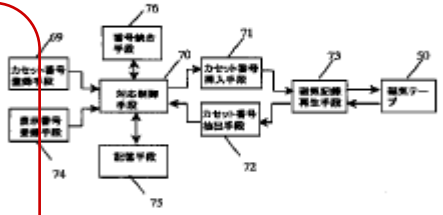
Ｆターム(参考)　5D110 AA04 AA26 AA28 DA08 DA12 DA14 DB07 DB11 DB19 DC03 DD13 DE08

(54)【発明の名称】　デジタル情報記録再生装置

(57)【要約】

【課題】　一つのカセットの磁気テープに複数のカセット番号が間違って記録される場合でも、ユーザにとって扱い易いデジタル情報記録再生装置を提供することを目的とする。

【解決手段】　複数のカセット番号に一つの表示番号を割り当てるとともに、磁気テープ位置が重複した録画番組は、録画開始日時の新しい方を残し、古い方を消去する番組統合手段を用いて番組情報を統合することにより、統合についてユーザに負担をかけないデジタル情報記録再生装置が得られる。



특허분류

출원번호

출원일

발명의 명칭

요약정보

공개정보

출원인

발명자

대리인

외국특허공보의 이해(INID 코드)

(10) Identification of the patent, SPC or patent document

* (11) Number of th

* (12) Plain langua

* (13) Kind-of-docu

(15) Patent correc

** (19) WIPO Stand

Notes: (i) For a

(ii) ** Mi

(iii) With

on a

(iv) Data

WIPC

(30) Data relating to priority under the Paris Convention or the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)

* (31) Number(s) assigned to priority application(s)

* (32) Date(s) of filin

* (33) WIPO Standa application nu applications fi

(34) For priority fili at least one o the regional o

Notes: (i) With t can be interna and sh

(ii) The pr Stand

(40) Date(s) of making av

(58) Field of search

Notes: (i) The presentation of the classification symbols of the International Classification for Industrial Designs should be made in accordance with paragraph 4 of WIPO Standard ST.10/C.

(ii) Wi cita pat

(60) References to oth unpublished applications

* (61) Number ar number of document

* (62) Number ar been divid

* (63) Number ar

(80) (90) Identification of data related to International Conventions other than the Paris Convention, and to legislation with respect to SPCs

(81) Designated State(s) according to the PCT

(83) Information concerning the deposit of microorganisms, e.g., under the Budapest Treaty

(84) Designated Contracting States under regional patent conventions

(85) Date of commencement of the national phase pursuant to PCT Article 23(1) or 40(1)

※ INID 코드(Internationally agreed Numbers for the Identification of bibliographic Data; 서지사항식별코드)는

- 지식재산권에 대한 국제기구인 WIPO(World Intellectual Property Organization)는 특허문서에 국제적으로 정해진 번호를 부여
- INID 코드는 특허 발행국이나 특허문서 종류에 관계없이 원하는 서지정보 및 기술적 정보의 확인을 가능하게 함

INID 코드

Numbers	Contents	
10	*Patent document*	*11 : 특허번호*
20	*Application for a patent*	*22 : 출원일*
30	*Priority*	*32 : 우선권출원일*
40	*Date(s) of making available to the public*	*43 : 출원공개일*
50	*Technical information*	*51 : 국제특허분류* *54 : 발명의 명칭* *57 : 요약 또는 청구의 범위*
60	*Other related domestic patent*	
70	*Parties concerned with the patent*	*71 : 출원인명* *72 : 발명자명* *73 : 특허권자(권리자)명* *74 : 대리인명*
80, 90	*International Conventions and legislation*	*81 : 지정국*

공보종류 코드(한국)

KR (Republic of Korea)	
Kind code	Description
A	공개특허공보
U	공개실용신안공보
B1	특허공보(공고) ※ 공고일이 **1997. 8. 31.** 이전인 특허
Y1	실용신안공보(공고)
B1	등록특허공보 ※ 공고일이 **1997. 9. 1.** 이후인 특허
Y1	등록실용신안공보

공보종류 코드(미국)

US (United States of America)	
Kind code	Description
A1	Utility Patent Application published on or after January 2, 2001
A2	Second or subsequent publication of a Utility Patent Application
A9	Correction published Utility Patent Application
B1	Utility Patent Grant (no pre-grant publication) issued on or after January 2, 2001
B2	Utility Patent Grant (with pre-grant publication) issued on or after January 2, 2001
C1	Reexamination Certificate (1st Level)
C2	Reexamination Certificate (2nd Level)
C3	Reexamination Certificate (3rd Level)
E1	Reissue Patent
F1	Reexamination Certificate of a Reissue Patent
H1	Statutory Invention Registration (SIR) Patent Documents. SIR documents began with the December 3, 1985 issue.
I4	Defensive Publication Documents issued from November 5, 1968 through May 5, 1987
P1	Plant Patent Grant issued prior to January 2, 2001
P2	Plant Patent Grant (no pre-grant publication) issued on or after January 2, 2001
P3	Plant Patent Grant (with pre-grant publication) issued on or after January 2, 2001
P4	Second or subsequent publication of a Plant Patent Application
P9	Correction publication of a Plant Patent Application
S1	Design Patent

공보종류 코드(일본)

JP (Japan)	
Kind code	Description
A	공개특허공보
A	공표특허공보 ※ 공개번호의 후반부가 '5'로 시작됨.
A1	재공표특허공보
U	공개실용신안공보
U	등록실용신안공보

공보종류 코드(PCT)

WO (PCT)	
Kind code	Description
A1	Publ.of the Int.Appl. with Int.search report
A2	Publ.of the Int.Appl. without Int.search REP.
A3	Subsequent Publ. of the Int. search report
B1	Publ. of amended claims
B8	Second modification of the First page
B9	Correction of a Complete Corrected Document
C1	Modified First page
C2	Complete Corrected Document

국제특허분류(IPC)의 이해

※ 국제특허분류(International Patent Classification)는

•국제적으로 통일화된 특허의 분류체계를 수립할 필요성
•“국제특허분류에 관한 Strasbourg 협정”에 따라 세계지식재산권기구(WIPO)가 1975년 10월에 제정

IPC분류의 구조

섹션
• F : 기계공학
서브섹션
• 일반공업
클래스
• 16 : 기계요소
서브클래스
• K : 밸브
메일그룹
• 1/100 : 리프트 밸브
서브그룹
• 1/02 : 나사 스핀들

IPC 코드

분류	섹션	서브섹션
A	생활필수품	농수산, 식료품, 가정용품, 의료, 의약
B	처리조작, 운수	분리, 금속가공, 비금속가공, 인쇄, 운수포장, 초미세기술
C	화학, 야금	무기화학, 유기화학, 석유, 바이오, 야금
D	섬유, 지류	섬유, 제지
E	고정구조물	건설, 광업
F	기계공학, 조명	엔진, 기계부품, 조명, 무기, 폭발
G	물리	컴퓨터, 정보매체, 원자력
H	전기	전기/반도체, 전자/통신, 기차

특허출원 시 대리인 선임 또는 직접 출원에 대한 방법 및 유의사항

2008-12-26 SKY Patent & Law Firm

대리인 선임 시 유의사항

전문분야

- 전기/전자, 기계, 화학, 바이오 등

구성원 역량

- 지식, 경험, 규모 등
- 특허사무소 규모보다 처리하는 담당자의 역량이 중요

위임 비용

- 너무 낮은 수수료는 ?
  - 특허사무소도 수익성을 고려하여 업무

대학특허 이해도

- 기업특허관리와 다른 대학특허관리의 특수성 이해 필요
  - 예산, 실적, 기술이전이 목적 등

특허사무소 선정/관리 시 참고

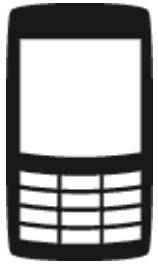
- 분야별로 2~3개로 집중 관리
- 신생 특허사무소에 진입기회 제공
- 거래 특허사무소의 주기적 평가를 통한 서비스 질 유지

전자 출원 방법

출원인코드 신청	• 특허청에 출원절차를 진행하기 위해 본인의 사용자 식별코드를 부여받는 단계
전자문서 이용신고	• 전자출원을 이용하기 위해 신원을 확인하는 단계
인증서 발급	• 온라인출원 및 전자문서교환을 위해 공인인증서를 등록하거나 특허청인증서를 발급하는 단계
서식/명세서 작성	• 출원서식을 특허路 홈페이지 또는 전자출원소프트웨어(서식작성기등)를 이용하여 문서 작성하는 단계
온라인 제출	• 작성된 전자문서를 특허청에 온라인 제출하고, 출원번호를 부여받는 단계
제출결과 조회	• 특허청에 제출한 출원서식의 처리결과 및 진행상태를 확인하는 단계

Thank you!

who@skyiplaw.com



+82 011 9502 8246